

平成27年度第1次募集（平成26年10月入学含む。）
新潟大学大学院自然科学研究科博士前期課程入学者選抜試験問題

一般入試

材料生産システム専攻
機能材料科学コース（物性系）

B1

専門科目（材料科学（物性系））

注意事項

- 1 この問題冊子は、試験開始の合図があるまで開いてはならない。
- 2 問題冊子は、表紙を含めて全部で7ページある。
- 3 解答用紙にも注意事項が記載されているので、その指示に従うこと。
解答は、すべて指定された解答用紙に記入すること。
指定された解答用紙の中に自由に記入してよいが、解答した問題が分かるようにすること。裏面に解答する場合も、その旨、表面に明記すること。
- 4 受験番号は、各解答用紙の指定された箇所に必ず記入すること。
- 5 解答時間は、180分である。
- 6 下書きは、問題冊子の余白を使用すること。

[I] 平面波の重ね合わせと不確定性関係に関する以下の設問 (1) ~ (8) に答えよ。必要であれば、積分公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx = 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

を使用せよ。

(1) 1次元自由粒子の波動関数は、波数を k として平面波 $\phi_k(x) = e^{ikx}$ と表される。 $\phi_k(x)$ が運動量が確定値をとる状態であることを示し、確定値を求めよ。

(2) 次に波数の異なる平面波を重ね合わせた状態を $\Psi(x)$ として、

$$\Psi(x) = A \int_{-\infty}^{\infty} g(k) e^{ikx} dk, \quad (1-1)$$

$$g(k) = \exp\left[-\frac{a^2}{2}(k - k_0)^2\right] \quad (1-2)$$

を考える。ここで、 $A, a(>0), k_0$ は定数である。積分を実行すると

$$\Psi(x) = A \sqrt{\frac{2\pi}{a^2}} \exp\left[-\frac{x^2}{2a^2} + ik_0x\right] \quad (1-3)$$

となる。規格化定数 A が $A = \sqrt{\frac{a}{2\pi\sqrt{\pi}}}$ となることを示せ。

(3) 式 (1-2) の $g(k)$ の概形を図示せよ。

(4) 式 (1-3) の $\Psi(x)$ に対して、運動量の期待値 $\langle p \rangle$ が、 $\langle p \rangle = \hbar k_0$ となることを計算によって示せ。

(5) 前設問 (4) において、 $\langle p \rangle = \hbar k_0$ となる理由を式 (1-1) と (1-2) の意味と設問 (3) の $g(k)$ の概形に基づいて説明せよ。

(6) $|\Psi(x)| = \sqrt{\frac{1}{a\sqrt{\pi}}} \exp\left[-\frac{x^2}{2a^2}\right]$ の大まかな広がり Δx は、実空間で粒子が存在する確率が高い領域を表す。 Δx は、 x^2 の期待値 $\langle x^2 \rangle$ を用いて $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$ で定義される。 $\Delta x = a/\sqrt{2}$ となることを示せ。

(7) 前設問 (6) の $|\Psi(x)|$ と Δx の対応関係との類推から、 $g(k)$ の k 空間での大まかな広がり Δk を求めよ。

(8) 設問 (6) と (7) から得られる $\Delta x \Delta p$ を不確定性関係 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ と比較して、状態 $\Psi(x)$ はどのような状態であるか答えよ。

[II] N 個の同一粒子からなる系がある。各粒子は独立で、各々のエネルギーが 0 と $\varepsilon_0 (>0)$ の2つの状態をとる。系の体積 v は温度 T によらず一定とする。系の全エネルギーを E 、エントロピーを S 、 $dE = TdS$ とし、以下の設問 (1) と (2) に答えよ。ただし、ボルツマン定数を k とし、 $\beta \equiv 1/kT$ とする。

(1) 分配関数 z と熱力学的な諸量の間になり立つ一般的な関係について、以下の問①～③に答えよ。ここで、系の取り得るエネルギー準位を ε_i とすると、

$$z = \sum_i \exp(-\beta\varepsilon_i) \text{ で与えられる。}$$

① $E = \langle \varepsilon_i \rangle$ とするとき、 E を $\log z$ と β で表せ。ここで、 $\langle \rangle$ はアンサンブル平均を意味する。

② 自由エネルギー F を $F = E - TS$ とすると、 $dF = -SdT$ となることを示せ。

③ $F = -kT \log z$ となることを示せ。

(2) この系の一粒子の分配関数を z_1 とし、以下の問①～⑤に答えよ。

① z_1 を $\beta\varepsilon_0$ の関数として表せ。

② N 粒子系の分配関数を z_1 と N の関数として表せ。

③ この系の比熱 C_v を N, ε_0, β の関数として求めよ。

④ $kT \ll \varepsilon_0$ のとき、 $C_v(T) \approx Nk \left(\frac{\varepsilon_0}{kT} \right)^2 \exp\left(-\frac{\varepsilon_0}{kT}\right)$ となることを示せ。

⑤ $kT \gg \varepsilon_0$ のとき、 C_v を T の関数として表せ。

[Ⅲ] 半導体に関する以下の設問 (1) と (2) に答えよ。

(1) 長さ L , 幅 W , 厚さ D の直方体の n 形半導体において, 長さ方向に電圧 V が印加され, 電流 I が流れている。ただし, 電流は一様な密度で流れていて, 正孔濃度は無視できるとする。以下の問①~⑤に答えよ。

- ① n 形半導体の導電率 σ を, 電流 I および印加電圧 V を用いた式で表せ。
- ② n 形半導体中の電子の速度 v を, 印加電圧 V を用いた式で表せ。ただし, 電子の移動度を μ とする。
- ③ 厚さ方向に磁束密度 B を印加した。このときの電子にはたらくローレンツ力の大きさを求めよ。ただし, 電子の電荷の大きさを q とする。
- ④ 前問③で十分な時間が経過したとき, 電流と磁束密度に垂直な向きにホール電圧 V_H が発生する。電子濃度 n が $n = \frac{IB}{DqV_H}$ と表せることを導け。
- ⑤ 移動度 μ を, ホール電圧 V_H と導電率 σ を用いた式で表せ。

(2) p 形半導体を用いた金属(M)-絶縁体(I)-半導体(S)構造で, 半導体と金属の間に電圧 V_G を印加する。電圧 V_G は半導体に対して金属が正となる場合を $V_G > 0$ とする。図 1 は V_G がゼロのときの熱平衡状態でのエネルギー帯図である。ここで, ϕ_M 及び ϕ_S はそれぞれ金属及び半導体の仕事関数で, $\phi_M = \phi_S$ である。 E_{FM} 及び E_{FS} はそれぞれ金属及び半導体のフェルミ準位, E_C 及び E_V はそれぞれ半導体の伝導帯下端及び価電子帯上端のエネルギー, E_I は禁制帯の中央の $(E_C + E_V)/2$ のエネルギー, ϕ_B は E_I と E_{FS} の差である。また, 図 2~4 の上段は異なるゲート電圧 V_G を印加したときのエネルギー帯図を示し, それらの下段は x 軸を接合界面に垂直な方向にとって, 絶縁体と半導体の接合界面を $x=0$ としたときの電荷密度 ρ の分布の様子に対応している。ただし, V_S は半導体内部に対する半導体表面の電位であり, それに相当するエネルギーの大きさが $q|V_S|$ で表されている。ここで q は電子の電荷の大きさ ($q > 0$) である。また, \ominus は中性のアクセプタ, \ominus はイオン化したアクセプタ, \bullet は電子, \circ は正孔を表している。以下の問①~④に答えよ。

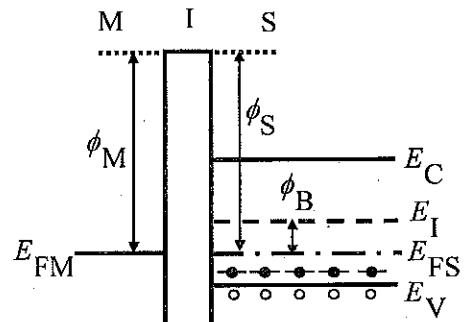


図 1 金属(M)-絶縁体(I)-半導体(S)構造における $V_G=0$ での熱平衡状態のエネルギー帯図。

[次ページに続く]

[問題 [III] の続き]

- ① 図 2 の上段は $V_G < 0$ でのエネルギー帯図を示す。金属の絶縁体界面付近には負の電荷が分布している。半導体で正孔が過剰に分布している領域 ($0 < x < x_a$) における ρ の様子を、解答用紙の図 a に描け。また、この領域は何層と呼ばれるかを答えよ。
- ② 図 3 の上段は $V_G > 0$ で、 V_G が小さい場合 ($|qV_S| < |\phi_B|$) でのエネルギー帯図を示す。金属の絶縁体界面付近には正の電荷が分布している。半導体で正孔が分布していない領域 ($0 < x < x_d$) における ρ の様子を解答用紙の図 b に描け。また、この領域は何層と呼ばれるかを答えよ。
- ③ 図 4 の上段は $V_G > 0$ で、 V_G が大きい場合 ($|\phi_B| < |qV_S| < 2|\phi_B|$) でのエネルギー帯図を示す。金属の絶縁体界面付近には正の電荷が分布しており、その量は前問②の場合よりも大きい。半導体で正孔が分布していない領域 ($0 < x < x_{dm}$) における ρ の様子を解答用紙の図 c に描け。また、電子の分布領域 ($0 < x < x_i$) は何層と呼ばれるかを答えよ。
- ④ 図 4 の半導体の絶縁体界面付近領域 ($0 < x < x_i$) において、電子濃度が正孔濃度より多い領域が形成される理由を「フェルミ準位」という言葉を用いて説明せよ。

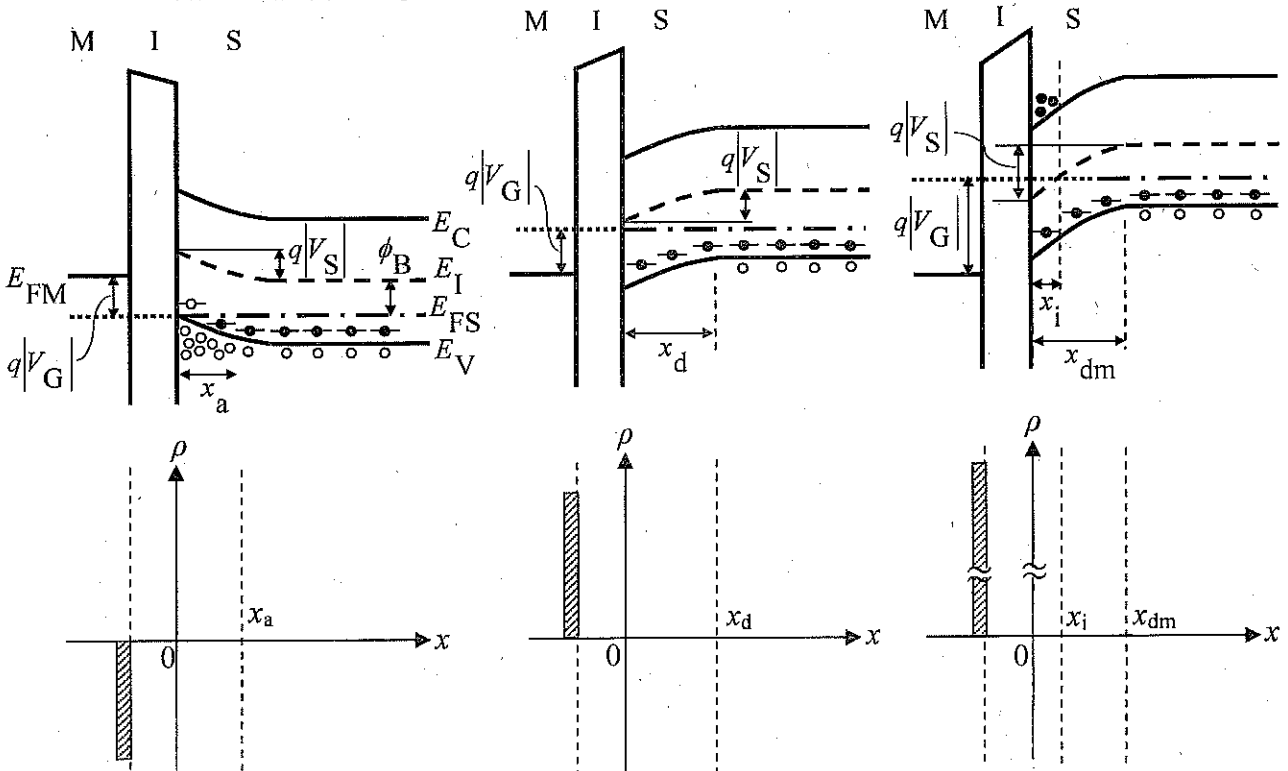


図 2 $V_G < 0$ でのエネルギー帯図と電荷分布の様子。

図 3 $V_G > 0$ で、 V_G が小さい場合 ($|qV_S| < |\phi_B|$) でのエネルギー帯図と電荷分布の様子。

図 4 $V_G > 0$ で、 V_G が大きい場合 ($|\phi_B| < |qV_S| < 2|\phi_B|$) でのエネルギー帯図と電荷分布の様子。

[IV] 同一原子からなる結晶の格子振動を簡単化し、質量 m の原子が一直線状に並んだ 1次元鎖の振動に関して考える。以下の設問 (1) ~ (3) に答えよ。

(1) まず、各原子が独立に振動を行うと仮定する。一つの原子に着目し、平衡点を座標原点 $x = 0$ 、平衡点の周りのポテンシャルを $U(x)$ とする。平衡点からの原子の変位が小さいとき、ポテンシャルは α を定数として $U(x) \sim U(0) + \frac{1}{2}\alpha x^2$ と展開することができる。以下の問①と②に答えよ。

- ① 古典力学に基づいて、原子の運動方程式を求めよ。
- ② 原子の振動数を求めよ。

(2) 次に、より現実的なモデルとして、隣り合う原子間の相互作用による連成振動について考える。このとき、格子振動は波動として結晶全体を伝わるようになる。それを以下のように定式化する。まず、格子定数を a とすれば、 l 番目の原子の平衡点 (格子点) の座標は $R_l = la$ となる。さらに、図 1 のように、 l 番目の原子が平衡点から x_l だけ微小変位しているとする。このとき、波数 q 、角振動数 ω の格子振動に対応する原子変位を

$$x_l = A \cos(qR_l - \omega t) + B \sin(qR_l - \omega t)$$

と表わすことができる。ただし、 t は時間、 A 、 B は時間によらない定数とする。以下の問①~④に答えよ。

- ① 波数 q を格子振動の波長 λ で表せ。
- ② 同時刻において、隣接する原子変位の位相差を答えよ。
- ③ 原子変位 x_l は波数 q の周期関数である。周期を求めよ。
- ④ 角振動数は波数 q に依存し、 $q = 0$ で $\omega(q) = 0$ となる。その理由を、 $q = 0$ での原子変位の特徴と関連づけて説明せよ。

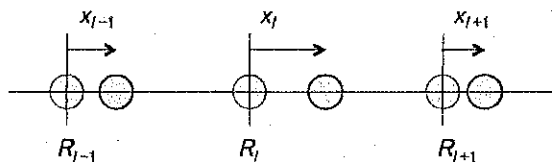


図 1

[次ページに続く]

[問題 [IV] の続き]

(3) 低温での格子振動による比熱について考える。量子力学によれば、格子振動は量子化され、フォノンの集団と見なすことができる。波数 q のフォノン1個のエネルギーを $\epsilon(q)$ とする。絶対温度を T 、ボルツマン定数を k 、プランク定数を \hbar として以下の問①~③に答えよ。

① 低温で熱励起されるフォノンの大多数は、条件 $\epsilon(q) < kT$ を満たす領域に存在する。この条件を、角振動数が $\omega(q) = c|q|$ と近似できることを用いて、波数 q が満たすべき条件に書き換えよ。ただし c は q によらない定数である。

② 前問①の条件において、上限の波数を q_m とする。波数 q の励起フォノンの数 $n(q)$ は、 $|q| > q_m$ に対して $n(q) = 0$ 、 $|q| < q_m$ に対して $n(q) = kT/\epsilon(q)$ と近似できる。低温での全エネルギーが T^2 に比例することを示せ。

③ フォノンによる低温比熱は T の何乗に比例するか答えよ。